

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 25 年 4 月 11 日 (2013.4.11)

【公開番号】特開 2012-126967 (P2012-126967A)

【公開日】平成 24 年 7 月 5 日 (2012.7.5)

【年通号数】公開・登録公報 2012-026

【出願番号】特願 2010-280396 (P2010-280396)

【国際特許分類】

C 2 3 C 18/31 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 18/31 E

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 2 月 25 日 (2013.2.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 4 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 4 4】

引き続き、同様の操作を繰り返してめっきを行ったところ、処理する基板 19 の積算面積が 410 m^2 になった時点においても問題なくめっき処理が可能であった。初期のめっき液比重 1.032 (at 20) であったのに対し、このときのめっき開始時点では比重 1.103 に増加した。これは、硫酸ニッケルの補給によりめっき液中に硫酸イオンが増加したことによるものである。しかし、処理する基板 19 の積算面積が 410 m^2 になった時点でもめっき液はきわめて安定であり、めっき槽 2、曝気槽 4 及び金属ニッケル溶解槽の内壁にはニッケルの析出が認められなかった。また、めっき膜も光沢を呈する平滑な表面であった。